

ADVANTEST[®]

MASK MVM-SEM[®]

E3650

Sub-10nmノードフォトマスク対応 多次元観察・測長SEM



「E3650」は、独自の電子ビーム走査技術を用いて、フォトマスクの微細パターン寸法をより高い精度と安定性で計測します。フォトマスク用SEM市場で広く支持されている当社「E3600シリーズ」の最新機種として、測定スループットを前機種「E3640」より2倍に向上。多重露光によるマスク枚数の増加、およびパターニングの複雑化による測定点数の増加に対応可能な、高スループットを実現しました。最先端フォトマスクに加え、EUVマスクやナノインプリント用マスターテンプレートの測定にも優れた性能を発揮します。

E3650の特長

- **MAM Time**、測定精度大幅向上

前機種「E3640」と比べMAM Timeは1/2に、測定精度は30%向上しました。

※MAM Time=Move Acquire Measure Time

- **ラージフィールド測定 (広視野測定)**

高精度広視野SEM画像による多点同時測定を実現しました。さらに、高精度のSEM輪郭像抽出機能により、リソグラフィシミュレーションを強力にサポートします。

- **CD測定の長期安定度の向上**

ZステージによるFocus制御方式、およびオゾンによるIn situ Cleaning技術を採用し、無調整で長期間安定したCD測定を可能にしました。

- **DBM (Design Based Metrology)対応**

設計情報を基にしたルールベース・アプローチにより、多点測定レシピを自動生成し、ホットスポットや狭小パターンを高精度に測定できます。

- **3D観察**

当社従来機種と同様、複数の検出器出力から3Dイメージを再構成する機能を備えています。

MVM-SEMは、(株)アドバンテストの日本、米国およびその他の国における登録商標または商標です。



●本製品を正しくご利用いただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

●本カタログ記載の製品仕様および外観等は、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

ADVANTEST®

<https://www.advantest.com/>

株式会社 **アドバンテスト**

●お問い合わせは
ナノテクノロジー事業本部
〒349-1158 埼玉県加須市新利根1-5 埼玉R&Dセンタ
TEL:0480-72-6300
E-mail:PDL-AT-info_nano@advantest.com